

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 19 AUG 2004

W. J.

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 4888	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/02218	国際出願日 (日.月.年) 27.02.03	優先日 (日.月.年) 03.12.02	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> H01L21/68, H01L21/02, B65G49/07			
出願人 (氏名又は名称) 近藤工業株式会社			

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で 1 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

I ☒ 国際予備審査報告の基礎II ☐ 優先権III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成IV ☐ 発明の単一性の欠如V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明VI ☐ ある種の引用文献VII ☐ 国際出願の不備VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 04.11.2003	国際予備審査報告を作成した日 02.08.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)	3S	7523
	柴沼 雅樹 電話番号 03-3581-1101 内線 3390		

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

- ☒ 明細書 第 1-30 ページ、出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、付の書簡と共に提出されたもの

- ☒ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 1-3 項、08.04.2004 付の書簡と共に提出されたもの

- ☒ 図面 第 1-34 ページ/図、出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)という翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)という国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3という翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 3	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1 - 3	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1 - 3	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲 1 - 3 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性を有する。

文献 1, 2 には、「ウェハ搬入開口部周囲とウェハ密閉容器の周囲の間に方形棒状フィルターを通過した清浄空気の環状エアカーテンを形成するエアカーテン形成装置」が記載されておらず、そのことにより本願発明は「密閉容器外部のエアが密閉容器内に入ることを完全に防止することができる」という有利な効果を奏する。

## 請求の範囲

1. (補正後) ウェハ搬入開口部を備える半導体製造装置に至るまでのウェハの搬送をウェハ密閉容器により行うミニエンバイラメント方式の半導体製造装置に取り付けられるエアカーテン形成装置であって、

前記ウェハ搬入開口部の周囲に取り付けることができ前方に向かって環状エアカーテンを噴出する空気噴出スリットを備え方形枠状に形成されたケースと、前記方形枠状ケース内に配設され断面が円筒形の方形枠状エアフィルター管と、前記方形枠状エアフィルター管に空気を供給して前記方形枠状エアフィルター管を通過した空気を前記スリットから噴出させるための空気供給手段と、該空気供給手段と前記方形枠状フィルター管を流体連通させる送気チューブとを含んでなり、前記密閉容器が半導体製造装置の前記ウェハ搬入開口部の前に位置して開かれたときに前記密閉容器の開かれた開口部に外部空気が流入することを防止するために前記ウェハ搬入開口部周囲と前記ウェハ密閉容器の周囲の間に前記方形枠状フィルターを通過した清浄空気の環状エアカーテンを形成するエアカーテン形成装置。

2. (補正後) 前記ケースは前記フィルター管を通過した清浄空気の向きを定めるガイド板を含んでなる請求項1に記載のエアカーテン形成装置。

3. (補正後) 前記送気チューブを半導体製造装置の前面壁に取り付け、前記前面壁に形成された前記ウェハ搬入開口部の周囲に設けた切欠き内に前記ケースを配設した請求項1に記載のエアカーテン形成装置。